

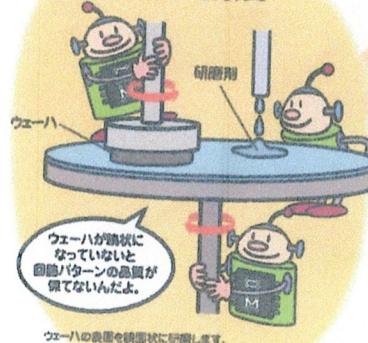
回路設計・パターン設計



インゴットの引き上げ



ウェーハの研磨



半導体のできるまで

Semiconductor Manufacturing Process

フォトマスク作成



前工程

ウェーハ表面にパターン形成



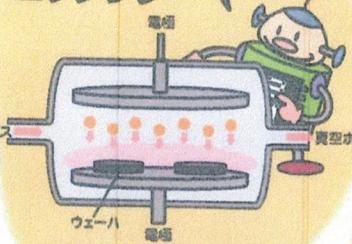
インゴットの切断



フォトレジスト塗布



エッティング



酸化・拡散・CVD・イオン注入



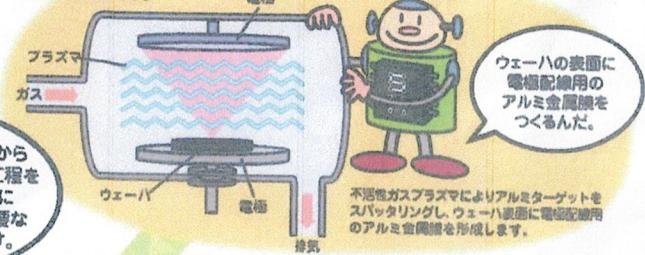
平坦化(CMP)



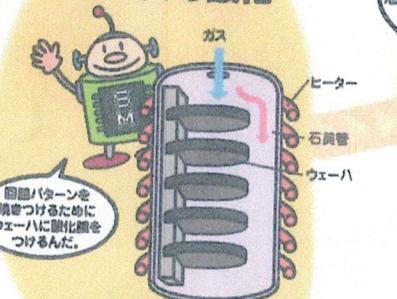
繰り返し



電極形成



ウェーハの酸化



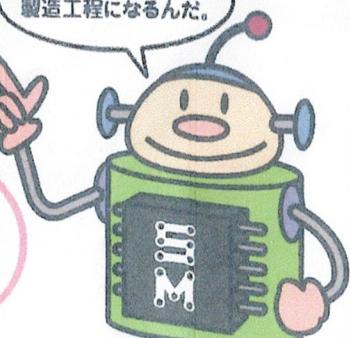
フォトレジストを塗めて薄く均一に塗布して、ウェーハに感光性を持たせます。

ウェーハ検査



テスター

ここまでがICチップの製造工程になるんだ。



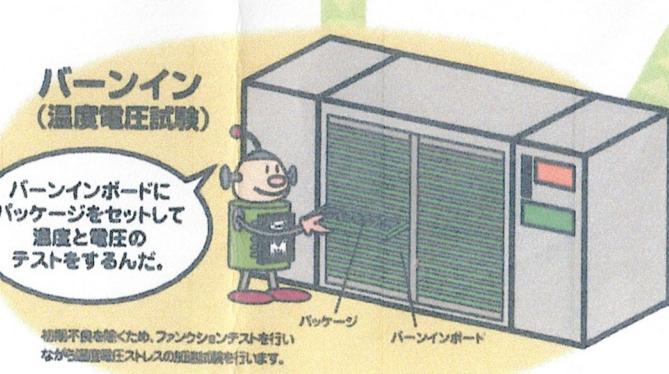
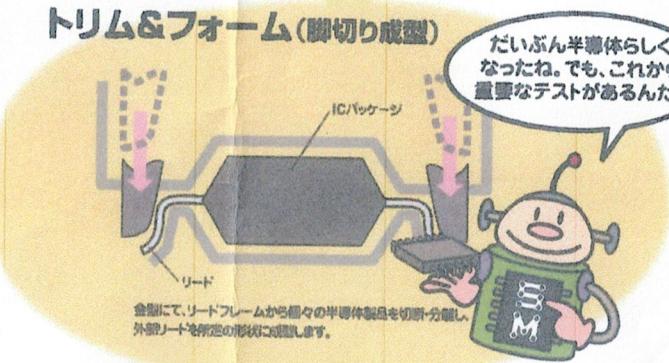
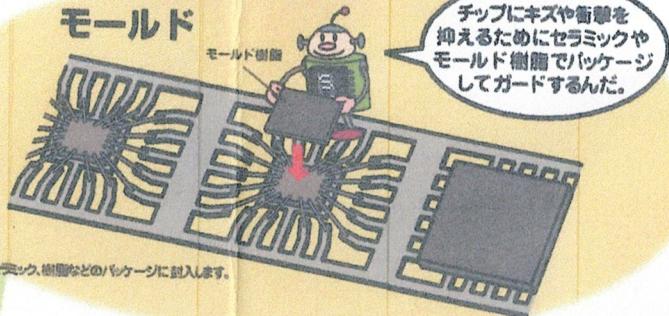
半導体のできるまで

Semiconductor Manufacturing

SEAJ 一般社団法人 日本半導体製造装置協会
2017.02



後工程



製品検査・信頼性試験

